

Title	高速電子ビームガイディングによる高速点火核融合の コア加熱高効率化		
Author(s)	城崎, 知至		
Citation	サイバーメディアHPCジャーナル. 2012, 2, p. 19-22		
Version Type	VoR		
URL	https://doi.org/10.18910/70530		
rights			
Note			

Osaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University

高速電子ビームガイディングによる高速点火核融合のコア加熱高効率化

城﨑 知至

広島大学 大学院工学研究院 エネルギー・環境部門

1. はじめに

コーンガイド高速電子加熱による高速点火方式レ ーザー核融合[1]では、超高強度レーザー照射により コーン内で生成される高速電子がコーンチップから 爆縮コアまでの 50µm~100 µm の距離を伝播し、爆 縮コアにてその運動エネルギーを付与し、コアを点 火温度まで加熱する。核融合点火を実現し、高利得 を達成するには、高速電子ビーム特性のコントロー ル(加熱レーザーから高速電子へのエネルギー変換 高効率化、高速電子スペクトルの最適化、ビーム発 散角の最小化、コアまでの高速電子ガイディング等) が最も重要な課題の一つである。これまでの研究[2] より、高速電子ビームは生成時に非常に大きな発散 角を有する(全角で~100°)事が明らかになり、加熱効 率を低下させる主要因となっている。高速電子ビー ムガイディングの手法として、自己磁場を用いた方 法がいくつか提案されている(拡張二重コーン[2]、 多層コーン+ガイディングワイヤー[3])。また、外 部磁場を印加する方法[4]も提案されている。

本研究では、抵抗性自己磁場による高速電子ビー ムガイディング方について、2次元輻射流体コード、 粒子(2D PIC)コード、フォッカープランク(2D FP)コ ードを結合した統合シミュレーション[2]によりそ の基礎特性を評価し、加熱効率向上を目的としたビ ームガイディングコーンデザインの提案を行った。

2. 高速電子生成時のビーム発散角

2D PIC シミュレーションにより高速電子ビーム の発散角を評価した[2]。シミュレーションでは、開 き角 30 度(全角)の金コーンに強度 3×10^{19} W/cm²、パ ルス長 1ps の超高強度レーザーを照射し、生成した 高速電子の分布関数 $f_{fe}(E, \theta, y, t)$ (E, θ, y およびtはエネ ルギー、運動方向の極角、伝播垂直方向の位置およ び時間)をコーンチップ内で観測した。シミュレーシ

ョン条件や結果については参考文献[2]に詳述して ある。観測した高速電子の角度分布については、"粒 子"分布の広がり $f_{f_{e,n}}(\theta) = \iiint f_{f_e}(E,\theta,y,t) dt dy dE$ とエ ネルギーを掛けて評価した"エネルギー"分布の広 がり $f_{f_{e,E}}(\theta) = \iiint E \cdot f_{f_e}(E,\theta,y,t) dt dy dE$ によって評価 した。シミュレーションで得られた角度広がりの一 例を図1に示す。両分布とも最大値を1となるよう に規格化している。また、0~θまでに占める割合 $F_{fe,n}(\theta) = \int_0^\theta f_{fe,n}(\theta') d\theta' / \int_0^{2\pi} f_{fe,n}(\theta') d\theta' \quad , \qquad F_{fe,E}(\theta) =$ $\int_{0}^{\theta} f_{fe,n}(\theta') d\theta' / \int_{0}^{2\pi} f_{fe,E}(\theta') d\theta'$ も同時にプロットした。 "粒子"分布ならびに"エネルギー"分布の広がり ともに指数関数 $Aexp(-\theta \Delta \theta)$ によりフィットでき、 $\Delta \theta$ の値は、 $f_{\text{fe},\text{fe}}(\theta)$ および $f_{\text{fe},\text{fe}}(\theta)$ に対してそれぞれ 75° と 55°であった。また、ビームエネルギーの 50%が $\theta < 30^{\circ}$ に、90%が $\theta < 60^{\circ}$ に含まれる。このように ビーム広がりが大きいために、発生した高速電子の 多くは爆縮コアに向かわず、結果として加熱効率低



図1 発生した高速電子の(a) "粒子" ならびに(b) "エネルギー"分布の角度広がり。

減の主因となっている。加熱効率向上の方策として は、発生する高速電子の発散角が小さくなるようレ ーザープラズマ相互作用をコントロールすることが まず挙げられるが、非線形過程である相互作用のコ ントロールは極めて困難である。そこで我々は、発 生後の電子ビームの伝播において、ビームガイディ ングによる加熱率向上を考えた。

3. 先鋭トンガリチップコーンによる抵抗性自発 磁場ガイディング

高密度プラズマにおける磁場の生成は、ファラディの法則、オームの法則ならびにビーム電流とバルク電子による帰還電流間での準電流中性条件 $(\vec{j}_{fe} = -\vec{j}_{be})$ より導出される。

 $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \eta (\nabla \times \vec{j}_{fe}) + \nabla \eta \times \vec{j}_{fe}$ (1).

ここでηはプラズマ抵抗率である。(1)式左辺第1項 により生成される磁場による高速電子ビームの自己 収束効果についてはいくつかの報告が成されている [5,6]。しかし、高速電子ビームの発散角が大きい場 合、自己収束効果は期待できない。(1)式左辺第2項 は、抵抗率の空間勾配と高速電子ビームの伝播方向 とが非平行な場合に磁場が生じることを意味してい る。高速電子が高抵抗率領域から低抵抗率領域に抜 けようとする場合、この磁場は高抵抗率領域に高速 電子を閉じ込める効果を持つ[7]。この機構を利用 し、高速電子をコアまでガイドする方法として、我々 は先鋭トンガリチップコーンを提案した(図2)。通常 コーンの先端部(チップ)をコア方向に拡張し、且 つ先端部を絞り込むことで、コーン外側壁の物質境 界に抵抗性磁場が生成し、高速電子をチップ内に閉 じ込め、コア方向へとガイドするとともにビーム径 を絞ることが可能と考えた。数 MeV の高速電子を



図2 先鋭トンガリチップコーンの概念図。

閉じ込めるためには数 kT の磁場が必要となる。Au のような高 Z 物質の方が抵抗率の空間勾配が大き く、発生する磁場強度も大きくなるが、このような 高 Z 物質中では高速電子とバルク粒子間の衝突によ るエネルギー損失や散乱が大きくなり、ガイディン グ効果を打ち消す可能性もある。そこで我々は、Z の異なるいくつかの物質(Au, Cu, Al, DLC)について、 ガイディング性能並びにコア加熱特性を評価した。 評価は通常のチップ先端部が平坦な Au コーン (チ ップ部厚み 7um)の結果と比較することで行った。

シミュレーションではまず 2 次元輻射流体コー ドにより爆縮シミュレーションを行い爆縮コア並び にチップ先端部のプロファイルを評価し、また 2D PIC コードにより高速電子プロファイルを評価し、 両プロファイルを用いて 2D FP コードによりガイデ ィング・加熱特性評価を行った。

3.1 爆縮コアプロファイル

コーン付き CD シェルターゲットに対する爆縮 シミュレーションより得られた最大圧縮近傍の燃料 コアおよびコーンチップ先端部の密度プロファイル を図3に示す。上図が通常の先端部がフラットな Au コーン、下図が DLC 先鋭トンガリチップコーンであ る。燃料コア密度ならびに面密度の最大値、最大値 達成時刻にはチップ形状(フラット/先鋭とんがり)や



図 3 爆縮シミュレーションより得られたコアおよび コーンチップの密度プロファイル。上が通常のAuフ ラットトップコーン、下が DLC 先鋭トンガリチップ コーン。縦横軸は空間座標(r,z)で単位はミクロン。 材質(Au, Cu, Al, DLC)による差異はなく、先鋭トンガ リチップによる爆縮への影響はほとんど無い。また、 図中の実線はチップと爆縮プラズマの境界を示して おり、トンガリチップの場合、若干形状がゆがんで はいるが、コア近くまでチップ部が残っており、ガ イディング効果が期待される。

3.2 高速電子プロファイル

加熱レーザー照射により発生する高速電子プロ ファイルは 2D PIC シミュレーションにより評価し た。開き角 30°(全角)のコーン(加熱レーザーの プレパルス等により生成されるプレプラズマはない と仮定)に強度 3×10¹⁹W/cm²、パルス長 1ps の加熱 レーザーを照射した場合に得られた高速電子プロフ ァイルを用いた。図 1 は、この計算より得られた高 速電子の角度広がりで、図4にスペクトルを示す。 低エネルギー成分(E < 3MeV)はエネルギーの冪乗に 従い、高エネルギー成分(E>5MeV)は指数関数でフィ ットできる。このときの高エネルギー成分の傾斜温 度は 3.2McV であった。



図 4 粒子シミュレーションより得られた高速電子の エネルギースペクトル。

3.3 先鋭トンガリチップコーンによる加熱特性

得られたプラズマプロファイル並びに高速電子 プロファイルを用いてコア加熱特性を 2D FP シミュ レーションにより評価した。高速電子ビームは爆縮 コア中心までの伝播距離が 50µm となるように、図 3のr=13µm の位置から入射した。

高速電子ビーム入射開始から 1ps 経った時点で

の磁場強度分布と高速電子の密度分布を図 5 に示 す。上の 2 図が通常の Au フラットトップコーンの 場合で、下の 2 図が DLC 先鋭トンガリチップコーン の場合である。Au フラットトップコーンの場合、コ ーン先端部が爆縮からのプラズマジェットにより押 しこまれて変形しており、ここに高速電子が流れる ことで強い抵抗性自発磁場が形成されている。生成 時に大きな発散角を持つ高速電子ビームは、この磁 場によりさらに散乱され、コア領域での高速電子密 度が低くなり、結果として加熱効率は低くなる。一 方、DLC 先鋭トンガリチップコーンの場合、コーン 側壁に沿って高速電子をチップ内に閉じ込め、コア 方向にガイドする磁場が形成されている。この磁場 により、比較的低エネルギーの高速電子はコアへと ガイドされるため、高密度コア領域における高速電



図 5 Fokker-Planck シミュレーションより得られた磁場
B と高速電子密度 N_{fe}の空間分布。上2 図が Au フラットトップコーンで、下2 図が DLC 先鋭トンガリチップコーンの結果。

子密度は Au フラットトップコーンの場合よりも高 くなって折り、この結果、加熱効率が向上している。

前述したように、抵抗性自発磁場は抵抗率勾配が 大きいほど強くなる。よって、高 Z 物質をコーンチ ップ材として用いた方が磁場強度は強くなる。一方、 トンガリチップとしてチップ部を拡張した分、チッ プ内での高速電子の伝播距離は長くなり、バルク粒 子との衝突効果が大きくなり、これは高 Z 財ほど顕 著となるため、負の効果も生じうる。そこで、チッ プ材を変えたシミュレーションを行い、加熱特性を 比較した。表Iに、異なる材質の先鋭トンガリチッ プコーンにおけるコーン側壁にできる磁場強度の最 大値 Bmax とチップ内で高速電子が失うエネルギー ΔE_{tin} 、ならびにコアに付与するエネルギー ΔE_{core} をま とめる。 ΔE_{tip} と ΔE_{core} については、Au フラットトッ プコーンの値を標準値とし、その値に対する相対値 を示す。コーン側壁に生じる抵抗性自己磁場強度は 1kT 程度であり、高Z材の方が強くなっていること がわかる。このため、ガイディング効果としては高 Z 材の方が大きくなることが期待される。しかし、 伝播距離が長いトンガリチップコーンでは、高Z材 ほどチップ内での高速電子のエネルギー損失が大き くなっている。結果として、Au トンガリチップコー ンの場合は後者の負の効果の方が強くなり、加熱効 率は Au フラットトップコーンよりも低くなってい る。中Z材である AIや DLC のトンガリチップコー ンの場合もチップ内でのエネルギー損失は Au フラ ットトップコーンよりは大きくなっているが、それ 以上にガイディング効果が強く、コア加熱エネルギ ーは Au フラットトップコーンよりも 30%程度高く なった。

表I 先鋭トンガリチップコーンによるコア加熱特性

チップ材	$B_{\rm max}$	$\Delta E_{\rm tip}^*$	$\Delta E_{\rm core}^*$
Au	1510T	2.05	0.9
Cu	11 93 T	1.98	1.05
Al	1204T	1.32	1.35
DLC	767T	1.47	1.31

*Auフラットトップコーンで得られた値に対する相対値

4. まとめと今後の展望

コーンガイド高速電子加熱による高速点火の加熱 率向上を目的とし、抵抗性自発磁場による高速電子 ガイディングを可能とする先鋭トンガリチップコー ンを提唱し、その特性評価を統合シミュレーション により行った。中 Z 材の先鋭トンガリチップコーン を用いることで、高速電子ガイディング効果により 加熱率を向上できることが示された。

今後、実験による検証や、更なる高強度・長パル スを用いた点火・燃焼クラスへの適用可能性等の評 価が必要である。本研究では、輻射流体並びに FP シミュレーションは NEC SX-8 および 9 を用いて、 PIC シミュレーションは PC クラスターを用いて行 った。いずれも 2 次元シミュレーションである。よ り実際的なシミュレーションには 3 次元シミュレー ションが必要であるが、計算時間やメモリ等の制限 により、現状では困難である。特に PIC シミュレー ションでは、PC クラスター32 ノード (128CPU/ 512GB memory)を用いた場合でも 2 次元で実スケー ル (時間・空間ともに)計算を行うのは困難である。 計算コードの高効率化・高並列化を行う必要がある とともに、更なる計算資源の大規模化も期待したい ところである。

本研究を遂行するに当たり多大なる支援を受けた 大阪大学サイバーメディアセンター並びにレーザー エネルギー学研究センター高性能計算機室の方々に 感謝する。

参考文献

- (1) R. Kodama, et al., *Nature* **418**, 933 (2002).
- (2) T. Johzaki, et al., Nucl. Fusion 51, 073022 (2011).
- (3) P. A. Norreys, "Recent Energy Transport Experiments on the Valcan Petawatt Laser Facility", presented at 37th EPS conf. on Plasma Phys., June 2010, Dublin, Ireland.
- (4) D. J. Strozzi, et al., Bull. APS 55, 68 (2010).
- (5) R. L. Robinson, and M. Sherlock, Phys. Plasmas 14, 083105 (2007).
- (6) T. Johzaki, et al., J. Phys. Conf. Series 112, 022091 (2008).
- (7) B. Ramakrsishna, et al., Phys. Rev. Lett. 105, 135001 (2010).